

**SEMINAR:
Plasma-Prozess-Technologie****am Donnerstag, den 09. März 2017
in Berlin-Adlershof****Veranstaltungsort:
SENTECH Instruments GmbH
Schwarzschildstr. 2, Berlin-Adlershof
Tel.: +49 30 6392 - 5520****Seminarprogramm**

9:00 **Begrüßung und Vorstellung des Programms**
SENTECH GmbH, Krailling

Ätztechniken:

- 09:10 **Plasmachemisches Ätzen von Silizium mit hohem Aspektverhältnis und geringer Seitenwandrauigkeit**
Marcel Schulze, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 09:40 **Verbesserte NO₂-Empfindlichkeit von Sensoren durch sanftes und schädigungsarmes Ätzen von AlGaIn/GaN Strukturen**
Roman Vitushinsky, RAM Group DE GmbH, R&D Center, Zweibrücken
- 10:10 Kaffeepause und Diskussion
- 10:30 **SCIL Nanoimprint Solutions: wafer scale sub-10nm patterning of functional layers**
Marc Verschuuren, Philips Group Innovation, Eindhoven, The Netherlands
- 11:00 **Nanophotonic integration enabled by ultra-smooth plasma etching technique**
Yuqing Jiao, Photonic Integration – COBRA Research Institute, TU Eindhoven, The Netherlands

Beschichtungstechniken:

- **PECVD**
- 11:30 **Vorstellung der SENTECH Ätz- und Beschichtungsanlagen mit ICPECVD und PEALD**
Hassan Gargouri, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 12:00 **Material- und Prozessaspekte PECVD-basierter Dünnschichtbauelemente**
Sebastian Polster, Fraunhofer Institut IISB, Erlangen
- 12:30 Mittagessen und Diskussion
- 13:30 **Low Temperature ICPECVD deposition of liquid precursor based oxides**
Xuemei Wang, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- **ALD**
- 14:00 **ALD optischer Schichten**
Adriana Viorica Szeghalmi, Fraunhofer Institut IOF, Jena
- 14:30 **PEALD mit CCP und ICP Plasma Quellen**
Franziska Naumann, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 15:00 Kaffeepause und Diskussion
- 15:15 **Intelligente und flexible Fertigung durch Verbindung von Ätz- und Beschichtungsmodulen in Vakuumclustern**
Tomasz Kwapien, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 15:45 **Alle Teilnehmer des Seminars sind zum Besuch der Applikationslabore bei SENTECH Instruments eingeladen**
- 16:30 *Ende des Seminars*